

株式会社ニューフレアテクノロジー
2026年3月30日

「Photomask Japan 2026 Technical Exhibition
第32回ホトマスク技術展示会」への出展について

ニューフレアテクノロジー (NFT) は、4月9, 10日にパシフィコ横浜アネックスホール (神奈川県横浜市) で開催される「Photomask Japan 2026 Technical Exhibition 第32回ホトマスク技術展示会」に出展します。

本展示会は、フォトマスクおよび次世代リソグラフィーマスク技術に関する国際シンポジウム「Photomask Japan 2026」に併設開催されるものです。

今回、NFT は、A14 ノードの半導体製造用マスク量産に対応したマルチ電子ビームマスク描画装置「MBM™-4000」、10/7nm~成熟ノードの半導体製造用マスクを透過反射同時検査により 60 分以下の高速で実現するマスク検査装置「NPI-8000 シリーズ」、ならびに各製品のロードマップを紹介します。

NFT は、電子ビームマスク描画装置のベースとなる電子技術とマスク検査装置のベースとなる光学技術の両技術を持っており、今後も、技術的シナジーを発揮して最先端の技術開発に邁進していきます。

【出展概要】

開催期間	4月9日(木)10:00~17:00、10日(金)10:00~16:00
会場	パシフィコ横浜 Annex Hall Booth No. 31
パネル展示	<ol style="list-style-type: none"> マルチ電子ビームマスク描画装置：MBM™-4000 マスク検査装置：NPI-8000 シリーズ (NPI-8000, 8000ML, 8000W) 製品ロードマップ

関連サイト

[Photomask Japan 2026 | Technical Exhibition \(Japanese\)](#)

以上